

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 4 月 4 日(04.04.2013)



(10) 国際公開番号
WO 2013/047190 A1

- (51) 国際特許分類:
G11B 5/84 (2006.01) *C03C 21/00* (2006.01)
C03C 19/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/073193
- (22) 国際出願日: 2012 年 9 月 11 日(11.09.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-217375 2011 年 9 月 30 日(30.09.2011) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): コニカミノルタアドバンストレイヤー株式会社
(KONICA MINOLTA ADVANCED LAYERS, INC.)
[JP/JP]; 〒1928505 東京都八王子市石川町 2 9 7
0 番地 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 遠藤 毅
(ENDO, Takeshi) [JP/JP]; 〒1918511 東京都日野市さ
くら町 1 番地 コニカミノルタテクノロジーセ
ンター株式会社内 Tokyo (JP). 宮本 宏
(MIYAMOTO, Hiroshi) [JP/JP]; 〒1918511 東京都日

野市さくら町 1 番地 コニカミノルタテクノロ
ジーセンター株式会社内 Tokyo (JP).

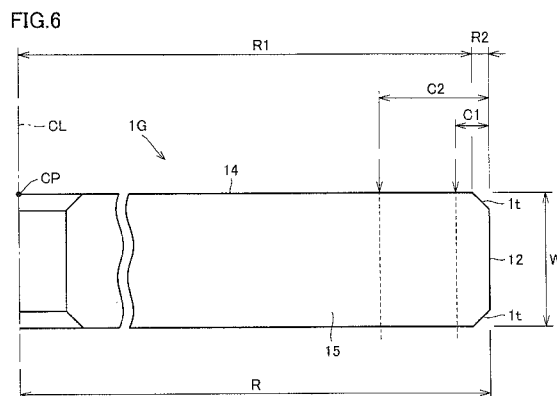
- (74) 代理人: 特許業務法人深見特許事務所 (Fukami
Patent Office, p.c.); 〒5300005 大阪府大阪市北区中
之島二丁目 2 番 7 号 中之島セントラルタワー
Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,

[続葉有]

(54) Title: PRODUCTION METHOD FOR GLASS SUBSTRATE FOR INFORMATION RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: 情報記録媒体用ガラス基板の製造方法

[図6]



(57) Abstract: In this production method for a glass substrate for a magnetic recording medium, a step in which a first surface-strengthened layer (101A) and a second surface-strengthened layer (101B) are polished is a step in which the first surface-strengthened layer (101A) and the second surface-strengthened layer (101B) are polished such that both a first polishing amount difference (P1) and a second polishing amount difference (P2) are no more than 0.10 μm , when: the difference between the polishing amount for the first surface-strengthened layer (101A) and the polishing amount for the second surface-strengthened layer (101B) in a first circumferential region (C1) having a distance in the diameter direction towards the rotation center (CP) from the outer peripheral edge surface (12) of 2.5 mm is called the first polishing amount difference (P1); and the difference between the polishing amount for the first surface-strengthened layer (101A) and the polishing amount for the second surface-strengthened layer (101B) in a second circumferential region (C2) having a distance in the diameter direction towards the rotation center (CP) from the outer peripheral edge surface (12) of 6.5 mm is called the second polishing amount difference (P2).

(57) 要約:

[続葉有]



WO 2013/047190 A1



NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI 添付公開書類:
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

この磁気記録媒体用ガラス基板の製造方法においては、第 1 表面強化層 (101A) および第 2 表面強化層 (101B) を研磨する工程は、外周端面 (12) から回転中心 (CP) に向かう半径方向距離が、2.5mm の第 1 円周領域 (C1) における第 1 表面強化層 (101A) の研磨量と第 2 表面強化層 (101B) の研磨量との差を第 1 研磨量差 (P1) とし、外周端面 (12) から回転中心 (CP) に向かう半径方向距離が、6.5mm の第 2 円周領域 (C2) における第 1 表面強化層 (101A) の研磨量と第 2 表面強化層 (101B) の研磨量との差を第 2 研磨量差 (P2) とした場合に、第 1 研磨量差 (P1) と第 2 研磨量差 (P2) とがともに、0.10μm 以下となるように、第 1 表面強化層 (101A) および第 2 表面強化層 (101B) の研磨を行なう。